

**МОСКОВСКАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ**  
**Заключительный этап**  
**Технологический профиль**  
**Индивидуальное тестирование по финальному кейсу**

---

**Финальный кейс «Тонкоплёночный резистор»**

№	Вопрос
1	Что такое экспонирование? а) процесс удаления засвеченных участков фоторезиста б) процесс равномерного нанесения фоторезиста в) процесс подготовки экспоната к выставке г) процесс засвечивания фоторезиста
2	Какое излучение наиболее часто используется в фотолитографии? а) инфракрасное б) радиочастотное в) ультрафиолетовое г) гамма-лучи д) видимое
3	После технологической операции проявления а) засвеченные участки растворяются б) засвеченные участки становятся тёмными в) засвеченные участки не растворяются г) засвеченные участки становятся светлыми д) фоторезист удаляется полностью
4	Для чего нужно экспонирование в фотолитографии? а) совмещение изображения с метками б) модификация плёнки фоторезиста в) равномерное нанесение фоторезиста г) воздействие на матрицу из фотоэлементов
5	Не влияет на скорость экспонирования фоторезиста а) светочувствительность фоторезиста б) мощность источника света в) толщина слоя фоторезиста г) материал подложки
6	Какой тип литографии Вы использовали при создании пленочного резистора? а) рентгенолитография б) электронная литография в) оптическая литография г) молекулярная литография
7	Какое вещество выделяется при электролизе водных растворов щелочей на аноде?
8	Какой способ травления металла был использован в финальном кейсе?
9	Напишите название закона: «Масса вещества, осаждённого на электроде при электролизе, прямо пропорциональна количеству электричества, переданного на этот электрод».
10	Что происходит с анионами на положительном электроде?